บรรณานุกรม

กมล เอี่ยมพนากิจ. (2547). *การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางหลายชั้นที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำ.* วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2542). การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลิเมอร์ โดยใช้เทคนิค Atomic Force Microscopy. *วารสารเทคโนโลยีวัสดุ*, (15), 46-50.

ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์. (2544). การสร้างและศึกษาลักษณะของอิเลคโทรดประเภทฟิล์มบางโปร่งแสง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีและวัสดุ, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. *รายงานการวิจัยประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม* (หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีพ แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Amora, S.B., Baud, G., & Jacquet, M. (1998). Characterization of zirconia films deposited by r.f. magnetron sputtering. *Materials Science and Engineering*, *57,* 30.

Bastianini, A., Battiston, G.A., Gerbasi, R., Porchia, M., & Daolio, S. (1995). Chemical Vapor Deposition of ZrO_2 Thin Films Using $Zr(NEt_2)_4$ as Precursor. *Journal de Physique IV, 5*, 525.

Bendoraitis, J. G., & Salomon, R. E. (1965). Optical Energy Gaps in the Monoclinic Oxides of Hafnium and Zirconium and Their Solid Solutions. *The Journal of Physical Chemistry, 69,* 3666.

Bernard, O., Huntz, A.M., Andrieux, M., Seiler, W., Ji, V., & Poissonnet, S. (2007). Synthesis structure microstructure and mechanical characteristics of MOCVD deposited zirconia films. *Appl Surf Sci, 253,* 4626-4640.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Bondars, B., Heidemane, G., Grabis, J., Laschke, K., Boysen, H., Schneider, J., & Frey, F. (1995). Powder diffraction investigations of plasma sprayed zirconia. *Journal of Materials Science, 30,* 1621-1625.

Brenier, R., Urlacher, C., Mugnier, J., & Brunel, M. (1999). Stress development in amorphous zirconium oxide films prepared by sol-gel processing. *Thin Slid Films, 338,* 136.

Bunshah, R. F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Choi, H.S., Seol, K.S., Kim, D.Y., Kwak, J.S., Son, C.S., & Choi, I.H. (2005). Thermal treatment effects on interfacial layer formation between ZrO_2 thin films and Si substrates. *Vacuum, 80,* 310-316.

Elsholz, F., Schöll, E., & Rosenfeld, A. (2004). Control of surface roughness in amorphous thin-film growth. *Applied Physics Letter, 84,* 4167.

Gao, P.T., Meng, L.J., dos Santos, M.P., Teixeira, V., & Andritschky, M. (2000). Influence of sputtering power and the substrate-target distance on the properties of ZrO_2 films prepared by RF reactive sputtering. *Thin Solid Films, 377-378,* 557-561.

_____. (2001). Infuence of sputtering pressure on the structure and properties of ZrO_2 films prepared by rf reactive sputtering. *Applied Surface Science, 173,* 84-90.

Gottmann, J., Husmann, A., Klotzbucher, T., & Krentz, E.W. (1998). Pulsed laser deposition of ceramic thin films using different laser sources. *Surf Coat Technol, 100-101*, 411-415.

Guinebretiere, R., Soulestin, B., & Dauger, A. (1998). XRD and TEM study of heteroepitaxial growth of zirconia on magnesia single crystal. *Thin Solid Films, 319,* 197.

Hembram, K.P.S.S., Dutta, G., Waghmare, U.V., & Rao, G.M. (2007). Electrical and structural properties of zirconia thin films prepared by reactive magnetron sputtering. *Physica B, 399,* 21-26.

Howard, C. J., Hill, R. J., & Reichert, B. E. (1988). Structures of ZrO_2 polymorphs at room temperature by high-resolution neutron powder diffraction. *Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 44,* 116.

Henri, J., & Jansen, F. (1991). Electronic structure of cubic and tetragonal zirconia. *Physical Review B, 43,* 7267-7278.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Huang, A.P., & Chu, P.K. (2005). Microstructural improvement of sputtered ZrO_2 thin films by substrate biasing. *Materials Science and Engineering B, 121,* 244-247.

Iwamoto, N.B., Makino, Y., & Kamia, M. (1987). Characterization of r.f.-sputtered zirconia coatings. *Thin Solid Films, 153,* 233.

Kim, D. J., Hahn, S. H., Oh, S. H., & Kim, E. J. (2002). Influence of Calcinations Temperature on Structural and Optical Properties of TiO_2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Dip Coation. *Materials Letters, 57*, 355-360.

Kim, J.S., Marzouk, H.A., & Reucroft, P.J. (1995). Deposition and structural characterization of ZrO_2 and yttria-stabilized ZrO_2 films by chemical vapor deposition. *Thin Solid Films, 254,* 33.

Lai, F., Lin, L., Huang, Z., Gai, R., & Qu, Y. (2006). Effect of thickness on the structure, morphology and optical properties of sputter deposited Nb_2O_5 films. *Applied Surface Science, 253,* 1801-1805.

Lubig, A., Buchal, C.h., & Gugg, D. (1992). Epitaxial growth of monoclinic and cubic ZrO_2 on Si(100) without prior removal of the native SiO_2. *Thin Solid Films, 217.*

Maissel, L. I., & Glang, R. (1970). *Handbook of Thin Film Technology*. New York: Mc Graw-Hill Book.

Manifacier, J.C., Gasiot, J., & Fillard, J.P. (1976). A simple method for the determination of the optical constants n, k and the thickness of a weakly absorbing thin film. *Journal of Physics K, 9,* 1002-1004.

Meher, A., Klumper-Westkamp, H., Hoffmann, F., & Mayr, P. (1997). Crystallization and residual stress formation of sol-gel-derived zirconia films. *Thin Solid Films, 308-309,* 363-368.

Mergel, D., Buschendorf, D., Eggert, S., Grammes, R., & Samset, B. (2000). Density and refractive index of TiO_2 films prepared by reactive eevaporation. *Thin Solid Films, 371,* 218-224.

Munz, W. D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology, 48*, 81-94.

Pamu, D., Sudheendran, K., Ghanashyam Krishna, M., James Raju, K.C., & Bhatnagar Anil, K. (2009). Ambient temperature stabilization of crystalline zirconia thin films deposited by direct current magnetron sputtering. *Thin Solid Films, 517,* 1587-1591.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Riviere, J.P., Harel, S., Guerin, P., & Straboni, A. (1996). Structure of ZrO_2 optical thin films prepared by dual ion beam reactive sputter deposition. *Surface and Coatings Technology, 84,* 470.

Rohde, S. L., & Munz, W. D. (1991). *Sputter Depostion in Advanced Surface Coatings: A Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Sanchez-Gonzalez, J., Diaz-Parralejo, A., Ortiz, A.L., & Guiberteau, F. (2006). Determination of optical properties in nanostructured thin films using the Swanepoel method. *Applied Surface Scienc, 252*, 6013-6017.

Smith, D. L. (1995). *Thin-Film Deposition : Principle And Practice.* New York: McGraw-Hill.

Sproul, W. D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. 35th Annual Technical Conference Proceedings. *Society of Vacuum Coaters*, 236-239.

Swarnalatha, M., Stewart, A.F., Guenther, A.H., & Carniglia, C.K. (1992). Optical and Structural Properties of Thin Films Deposited from Laser Fused Zirconia, Hafnia, and Yttria. *Applied Physics A, 54,* 533-537.

Swanepoel, R. (1983). Determination of the thickness and optical constants of amorphous silicon. *Journal of Physics E, 16,* 1214-1222.

Tomaszewski, H., & Godwod, K. (1995). Influence of oxygen partial pressure on the metastability of undoped zirconia dispersed in alumina matrix. *Journal of the European Ceramic Society, 15,* 17.

Venkataraj, S., Kappertz, O., Weis, H., Drese, R., Jayavel, R., & Wuttig, M. (2002). Structural and optical properties of thin Zirconium oxide films prepared by reactive DC megnetron sputtering. *Applied Surface Science, 92,* 3599-3607.

Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). *Thin Films Processes*. New York: Academic Press.

Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). *Handbook of sputter deposition technology: principles, technology and applications.* New Jersey: Noyes.

Wu, K.R., Wang, J.J, Liu, W.C., Chen, Z.S., & Wu, J.K. (2006). Deposition of Graded TiO_2 films Featured both Hydrophobic and Photo-Induced Hydrophilic Properties. *Applied surface Science, 255,* 5829-5838.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Wu, X., Landheer, D., Graham, M.J., Chen, H.W., Huang, T.Y., & Chao, T.S. (2003). Structure and thermal stability of MOCVD ZrO_2 films on si (100). *J Cryst Growth, 250,* 479-485.

Yu, G.Q., Tay, B.K., & Zhao, Z.W. (2005) Structure and properties of zirconium oxide thin films prepared by filtered cathodic vacuum arc. *Applied Physics A, 81,* 405-411.

Zhao, S., Ma, F., Song, Z., & Xu, K. (2008). Thickness-dependent structural and optical properties of sputter deposited ZrO_2 films. *Optical Materials, 30,* 910-915.

Zhao, S., Ma, F., Xu, K.W., & Liang, H.F. (2008). Optical properties and structural characterization of bias sputtered ZrO_2 films. *Journal of Alloys and Compounds, 453,* 453-457.

Zhao, X.T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M., & Masuda, M. (2005). Structure and Photo-Induced Features of TiO_2 Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering. *Microelectronics Journal, 36,* 549-551.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University